

光学ガラス関連のピッチ・ワックス洗浄剤

最 適 用 途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (℃)	使用法	使用条件	
					濃度 (%)	温度 (℃)
<u>研磨時の固定ピッチ、ワックスの洗浄</u> ピッチ、ワックス、保護膜、松脂、 芯取油、指紋等の洗浄	ケミクリーナー 3 7 6 1	原液	あり	US	原液	～ 4 0℃
	ケミゾール 2 6 0 0		なし			～ 5 0℃
	ケミゾール 2 6 1 7		なし			～ 5 0℃

※US…超音波

炭化水素系洗浄剤置換・コート前洗浄剤

最 適 用 途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (℃)	使用法	使用条件	
					濃度 (%)	温度 (℃)
軟硝材の洗浄 兼 炭化水素系洗浄剤の置換洗浄 炭化水素の置換、芯取加工油	ケミクリーナー 3 7 2 0	9	なし	US	1 ～ 3	2 0 ～ 4 0
	ケミクリーナー 3 7 7 0	1 2. 0			3 ～ 2 5	2 0 ～ 4 0
	ケミクリーナー 3 7 7 3	8. 5			3 ～ 1 0	2 0 ～ 4 0
軟硝材の洗浄 FK01、FCD1、FPL51～53、SK材、 LAK材等の軟硝材、蒸着前の洗浄	ケミゾール 2 6 1 3	1 0. 7	なし	US	2 0 ～ 原液	2 0 ～ 4 0
	CSクリーン	1 0. 8			0. 5 ～ 1	2 0 ～ 4 0

※US…超音波

ヤケ取り洗浄剤

最 適 用 途		洗浄剤名	pH 原液	引火点 (℃)	使用法	使用条件	
						濃度 (%)	温度 (℃)
ヤケ取り洗浄剤 研磨後のヤケ除去	LAK、SK材	ケミゾール 2 3 1 5	1 3.7	なし	U S	原液	2 5 ～ 4 0
	一般硝材	ケミゾール 2 3 1 6	1 4			原液	2 5 ～ 5 0
	FCD1 FK01 FPL	ケミゾール 2 6 1 3 ケミゾール 2 6 2 0	1 0.7			2 0 ～ 原液	2 5 ～ 4 0

※US…超音波

光学ガラスレンズ関連の剥離剤

最 適 用 途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (℃)	使用法	使用条件	
					濃度 (%)	温度 (℃)
<u>ガラスレンズ蒸着膜の剥離</u> <u>非球面ガラスの膜剥離</u> 単膜、マルチコート、多重コート膜 MgF ₂ 、SiO ₂ 、TiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、ZrO ₂ Ta ₂ O ₅ 、など 真空蒸着装置の基盤ドーム、治具剥離	ケミゾール 2 3 1 6 ケミゾール 2 3 1 8 ケミゾール 2 3 1 3	1 4 1 4 1 4	なし	浸漬	原液	6 0 ～ 8 0 6 0 ～ 8 0 6 0 ～ 7 0

※US…超音波

プラスチックレンズ関連の洗浄剤及び剥離剤

最 適 用 途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (℃)	使用法	使用条件	
					濃度 (%)	温度 (℃)
<u>プラスチックレンズモールド基材の洗浄</u> <u>母型（ガラス）に付着したウレタン系樹脂</u> 及びエポキシ系樹脂の剥離洗浄	ケミクリーナー 3 6 1 0 ケミゾール 2 3 0 3 ケミゾール 2 3 1 3	1 1. 8 1 4 1 4	なし	US	2. 5 ～ 3 原液（希釈） 原液（希釈）	2 0 ～ 4 0 5 0 ～ 6 0 5 0 ～ 6 0
プラスチックレンズの再生 プラスチックレンズのハードコート プライマー、マルチコート剥離洗浄	ケミゾール 2 3 1 8 ケミゾール 2 3 4 1	1 4 1 4	なし	任意	原液 原液	5 0 ～ 6 0 5 0 ～ 5 5

※US…超音波

- ◆洗浄・剥離剤の選定は、必ず予備試験を行って最適な製品を選定します。
- ◆各製品の詳細は、個別カタログとSDSを読んでからご使用下さい。